

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月21日(21.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/041493 A1

(51) 国際特許分類7: B28D 5/00, C03B 33/03, 33/023

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014080

(22) 国際出願日:

2003年11月4日(04.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-323112 2002年11月6日(06.11.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三星ダ イヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田二丁目12番12号 Osaka (JP).

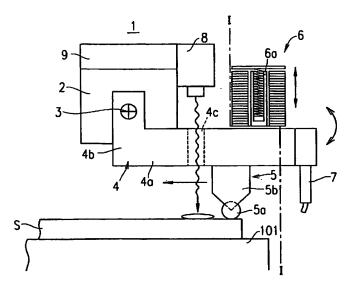
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 若山 治雄

(WAKAYAMA, Haruo) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹 田市 南金田二丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業 株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 山本 秀策, 外(YAMAMOTO,Shusaku et al.); 〒540-6015 大阪府 大阪市中央区城見一丁目 2-27、 クリスタルタワー15階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特 許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[続葉有]

- (54) Title: SCRIBE LINE FORMING DEVICE AND SCRIBE LINE FORMING METHOD
- (54) 発明の名称: スクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法



(57) Abstract: A scribe line forming method, wherein the wheel tip (5a) of a glass cutter (5) is moved in contact with the surface of a fragile material substrate (S) with a load of such a degree that does not give a damage to the surface of the fragile material substrate (S), a vertical crack is produced on the fragile material substrate (S) at a specified position by an armature (6) which gives a sharp impact force to produce the vertical crack of a specified depth to the glass cutter (5) moving on the fragile substrate (S), and the vertical crack formed by the wheel tip (5a) of the glass cutter (5) is extended along a predicted scribe line by a stress gradient produced by a compressive stress produced in a radiated area where laser beam is radiated from a laser beam transmitter (8) on the fragile material substrate (S) to the vertical cracks and a tensile stress produced in a cooled area which is produced by a cooling medium jetted from a cooling nozzle (7) to form a scribe line.





FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TP.), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書

(57) 要約: ガラスカッター5のホィールチップ5 a を、脆性材料基板Sの表面上に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動させ、この脆性基板S上を移動するガラスカッター5に対して所定深さの垂直クラックを発生させる急俊な衝撃力を与えるアマチュアー6によって、脆性材料基板S上の所望の位置に垂直クラックを発生させる。この垂直クラックに対して、脆性材料基板S上におけるレーザ光発振器8からレーザ光が照射される照射領域に生じる圧縮応力と冷却ノズル7から放出される冷却媒体によって発生する冷却領域に生じる引張応力とにより発生する応力勾配によって、ガラスカッター5のホィールチップ5 a によって形成された垂直クラックが、スクライブ予定ラインに沿って伸展させることによってスクライブラインを形成する。





明細書

スクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法

技術分野

5

15

20

25

本発明は、液晶ディスプレイ等に使用されるガラス基板等の脆性基板を分断するためのライン状のスクライブラインを形成するスクライブライン形成装置及び スクライブライン形成方法に関する。

背景技術

10 小型の情報端末、プロジェクションに適用可能な液晶ディスプレイは、情報処理技術の急速な進歩に伴うパソコン市場の拡大に伴って、そのニーズが幅広いものとなっており、今後の展開が期待されている。

特に、パソコン用、TV用の液晶ディスプレイにおいては、その表示画面を大型化、高精細化及び軽量化する要求が高まっており、この要求にあわせてガラス基板の大寸法化及び薄板化が進められている。そして、ガラス基板の大寸法化及び薄板化に伴って、このようなガラス基板を所望の寸法に高精細に分断する高度な基板分断技術が要求されるようになっている。

ガラス基板等の脆性基板は、ガラス基板の表面に所望の分断方向に沿ったライン状のスクライブラインを形成するスクライブ工程と、ガラス基板の表面上に形成されたスクライブラインに沿った曲げモーメントをかけることによりガラス基板をスクライブラインに沿って分断するプレーク工程とを実行することにより分断される。

ガラス基板にスクライブラインを形成するスクライブ工程では、垂直クラックのラインであるスクライブラインを、ガラス基板の表面に対して垂直下に深く浸透させて形成することができれば、後のプレーク工程において、スクライブラインに沿って分断する際の分断精度を向上させることができるので、垂直クラック

10

15

20

25



を深く形成させることは重要である。

例えば、実開昭59-88429号公報に示される様な手切りカッターを用いてカッターの先端に取り付けられたホイールチップをガラス基板の表面に加圧して転動させることによって、脆性材料基板の表面にスクライブラインを形成する場合がある。また、複数の脆性材料基板の表面に、数多くのスクライブラインを連続して自動的に形成させる装置として、例えば、特開昭55-116635号公報において開示されている装置を用いることが可能である。

ポイント式のダイヤモンドを用いてガラス基板の表面を切削することによりスクライブラインを形成する方法は、ガラス基板をポイント式のダイヤモンドで切削する過程でガラスの欠片(カレット)が必ず発生するので、液晶ディスプレイに使用されるガラス基板にスクライブラインを形成する場合には適していない。

また、回転可能に支持されたホイールチップをガラス基板の表面に加圧して転動させる方法では、エアシリンダ等の昇降機構を備えて、この昇降機構を用いて基板表面に対してホイールチップを加圧させて、垂直クラックを発生させている。

しかし、このような昇降機構を用いた加圧方式では、昇降機構による押圧力を 大きくしなければ、ガラス基板の表面に十分な深さの垂直クラックを容易には形成することが出来ない。また、押圧力を大きくすると、ガラス基板の端部にホイールチップを乗り上げさせる際に、ガラス基板の端部に欠け等の損傷が発生する おそれがあり、また、ガラス基板の平面部においても、ガラス基板を分断した際 に、分断面及び分断面を含むガラス基板の端面部に欠けを生じさせる原因となる 所望の方向でない方向にクラック(水平クラック)が発生する等の支障が生じる おそれがある。そして、この方法においても、スクライブ時にガラスカレットが 発生する。

さらに、ガラス基板に「反り」がある場合には、ホィールチップがこの「反 り」に起因する基板表面の凹凸に追従出来ず、ガラス基板の表面に適正な垂直ク ラックが得られないという問題がある。



本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、ガラス基板の端部に欠けが発生する等の支障をきたすことなく、ガラス基板に十分な深さを有する垂直クラックを発生させることができるスクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法を提供することを目的とする。

5

10

15

20

25

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明によれば、先端に刃先を有し、押圧力を付与して刃先を脆性基板の表面に押圧し、スクライブラインの起点となる垂直クラックを形成するための垂直クラック形成部材と、

該脆性基板上の所望の位置で、所定の深さの垂直クラックを発生させるために、 該垂直クラック形成部材に対して急俊な衝撃力を付与する衝撃力付与手段と、

該脆性基板の軟化点よりも低い温度の領域を形成する加熱手段と、

該脆性基板を冷却する冷却手段と、

該加熱手段、該垂直クラック形成部材、衝撃力付与手段及び該冷却手段を、脆性基板の表面上に予め設定されたスクライブ予定ラインに沿って一定の間隔をあけた状態で、脆性基板に対して相対移動可能に配置された配置移動手段と、

衝撃力付与手段の駆動を制御する制御部とを備えていることを特徴とするスクライプライン形成装置が提供される。

制御部は、刃先が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動されるよう垂直クラック形成部材および配置移動手段の駆動を制御し、刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライブラインを通過する通過点の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生させるよう衝撃力付与手段の駆動を制御する構成が好ましい。

加熱手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動から該 脆性基板表面の高さ変化を検出し、この検出結果に基づいて前記レーザ光発振器 から照射されるレーザ光の焦点を調整するためのサーボ機構を具備してなる構成



が好ましい。

5

10

15

20

冷却手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動に連動 して上下動するよう配置移動手段に配置されている構成が好ましい。

配置移動手段が、スクライブ予定ラインの前方側から、垂直クラック形成部材、 加熱手段及び冷却手段または、加熱手段、垂直クラック形成部材及び冷却手段の いずれかの順に前記3つの部材を配置してなる構成が好ましい。

配置移動手段が、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段を、互いの相 対位置を変更できるように配置してなる構成が好ましい。

冷却手段は、冷却媒体を放出する冷却ノズルであるものが挙げられる。

冷却手段は、冷却手段の高さ位置を調整するサーボ機構を有するものが挙げられる。

垂直クラック形成部材は、ホイールチップを刃先としてこれを転動可能に支持 したガラスカッターであるものが挙げられる。

加熱手段は、所定のレーザ光を照射するレーザ光発振器であるものが挙げられる。

衝撃力付与手段は、ソレノイドコイルへの通電をオンまたはオフすることによって、刃先を脆性基板表面上に押圧する移動慣性を発生させるアマチュアーであるものが挙げられる。

脆性基板の表面の高さ変化を検出するためのレーザ変位計または接触式変位計 をさらに具備してなるものが挙げられる。

脆性基板は、液晶表示装置用ガラス基板、プラズマディスプレイパネル用ガラス基板および有機ELディスプレイパネル用ガラス基板が挙げられる。

本発明の別の観点によれば、先端に刃先を有する垂直クラック形成部材を脆性 基板上を移動させながら刃先に急俊な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、

25 脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる工程と、

該垂直クラックに対して、基板上に設定されたスクライブ予定ラインに沿って、

15



該脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域を形成すると共に、該照射領域の 後方に冷却領域を形成してスクライブラインを形成する工程と、

を包含することを特徴とするスクライブ形成方法が提供される。

本発明のスクライブライン形成方法は、刃先が脆性基板の端部近傍および予め 形成されたスクライブラインと交差する点の近傍に位置したとき、衝撃力付与手 段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる構 成が好ましい。

図面の簡単な説明

10 図1は、実施の形態1のスクライブライン形成装置の概略を示す側面図である。 図2は、実施の形態1のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。 図3(a)~(e)は、それぞれ、実施の形態1のスクライブライン形成装置 によってスクライブラインを形成する方法を順番に説明する斜視図である。

図4は、実施の形態2のスクライブライン形成装置の概略を示す側面図である。 図5は、実施の形態2のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。 図6(a)~(e)は、それぞれ、実施の形態2のスクライブライン形成装置 によってスクライブラインを形成する方法を順番に説明する斜視図である。

図7は、実施の形態3のスクライブライン形成装置の概略を示す正面図である。

20 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明のスクライブライン形成装置及びスクライブライン形成方法について、図面に基づいて詳細に説明する。

(実施の形態1)

図1は、本実施の形態1のスクライブライン形成装置1の概略を示す側面図で 25 あり、図2は、図1のI-I線断面からのスクライブライン形成装置1の正面図 を示している。

10

15

20

25



このスクライブライン形成装置1は、図1及び図2に示すように、スクライブラインを形成する脆性材料基板Sを水平状態に固定するテーブル101を有している。ここで、本明細書で記載される脆性材料基板Sは、具体的には、マザー基板と呼ばれる大きな寸法の基板を意味している。ガラス製、セラミック製、半導体ウェハーなどの基板があって、それらが順次所定の小さな大きさに分断されて種々の用途に用いられる。脆性材料基板Sが固定されるテーブル101の側方の側壁102には、水平方向(紙面と鉛直な方向)に沿ったガイドレール103が設けられている。このガイドレール103には、内部に駆動モータを備えた駆動装置11の一端側が接続されている。駆動装置11には、駆動モータの駆動によりガイドレール103が延びる方向に沿って一定方向にスライド可能になっている。

この駆動装置11の他端側には、サーボモータ2が設けられている。このサーボモータ2は、駆動装置11が設けられた側とは反対側に、水平方向に所定長さに突出した回転軸3を有している。この回転軸3は、サーボモータ2により回転駆動されるようになっており、この回転軸3の先端部には、回転軸3と一体的に回転する支持フレーム4が取り付けられている。

サーボモータ2の回転軸3に取り付けられた支持フレーム4は、図1に示すように、平坦な板状に形成されたフレーム本体部4aと、このフレーム本体部4aの一端側から上方に所定高さに突出する突出部4bとを有しており、側面視で略しているように形成されている。この支持フレーム4は、突出部4bが設けられた一端側を、ガイドレール103に沿った進行方向の前方側(図1中の左方)に配置して、突出部4bの上端が、サーボモータ2の回転軸3に取り付けられている。

支持フレーム4におけるフレーム本体部4aの後方寄りの下面には、ガラスカッター5が取り付けられている。ガラスカッター5は、超硬合金または焼結ダイヤモンド等の超硬度を有する材質により形成されたホイールチップ5aと、この

10

15

20

25



ホイールチップ5aを回転可能に支持するホルダ5bとを有している。

ガラスカッター5は、ホルダ5 bの上端が、支持フレーム4のフレーム本体部4 aの下面に取り付けられることによって、支持フレーム4の移動に伴って一体的に移動するようになっている。ホイールチップ5 aは、円形状であって幅方向の中央部が最大径になるように突出している。このホイールチップ5 aは、下面を開放したホルダ5 bによって、軸心部が回転可能に支持されている。ホイールチップ5 aは、脆性材料基板S上において、垂直クラックを発生させる位置以外でも、常時、脆性材料基板Sの表面上に接触しており、脆性材料基板Sの表面上に対して所定以上の衝撃力が加わるように押圧されると、脆性材料基板S上に垂直クラックを発生させる。

支持フレーム4のフレーム本体部4aの上面のガラスカッター5の近傍には、衝撃力付与手段であるアマチュアー6が設けられている。このアマチュアー6の周囲には、下方に付勢するスプリング(図示せず)が装着されて、アマチュアー6は、常時、下方に付勢力が加わった状態になっている。また、アマチュアー6の内部には、所定電圧の印加により上方に持ち上げる電磁力を発生するソレノイドコイル6aが備えられており、電圧が印加された状態では、ソレノイドコイル6aによる上方への電磁力と、スプリングによる下方への付勢力とが平衡して、静止した状態になっている。そして、ソレノイドコイル6aへの電圧の印加、すなわちソレノイドコイル6aへの電流の供給が停止した場合に、ソレノイドコイル6aによる上方への電磁力が消失して、スプリングによる下方への付勢力によって、フレーム本体部4aの上面に、ガラスカッター5のホイールチップ5aを脆性材料基板Sの表面に対して垂直クラックが発生する程度の衝撃力が付与される。そして、再び所定の電圧が印加されると、上方への電磁力が作用して、静止状態に戻るようになっている。

なお、本実施の形態1では、電圧の印加が停止した場合に、スプリングの下方 への付勢力によって支持フレーム4のフレーム本体部4aに衝撃力が加えられる

10

15

20

25



機器構成とした場合について説明したが、逆に、通常の状態では、アマチュアー6がスプリングによる上方への付勢力によって静止状態に支持されていて、電圧が印加(電流が供給)された場合に、下方への電磁力が加わって、フレーム本体部4aに衝撃力が加わる機器構成としてもよい。後者の場合のほうが、電流の印加時間が短いので電力消費が少なくて済む。

支持フレーム4のフレーム本体部4aの後端部には、冷却媒体を放出するための冷却ノズル7が、フレーム本体部4aと一体的に取り付けられており、支持フレーム4のフレーム本体部4aが脆性材料基板S上の凹凸等により上下に移動しても、支持フレーム4のフレーム本体部4aの上下動に追従して移動できるようになっている。また、この冷却ノズル7は、所定の冷却媒体が冷却状態に貯蔵された図示しない冷却媒体源に接続されている。冷却ノズル7から放出される冷却媒体としては、冷却水、冷却アルコール等の低温液体、または、液状窒素、ドライアイス等を気化させて得られる窒素、二酸化炭素等の低温気体が用いられ、ヘリウムやアルゴンなどの不活性ガス、単なるエアなども用いられる。

サーボモータ2の後部側には、支持フレーム4における本体フレーム4 a の所定位置に形成された穴部4 c を介して脆性材料基板Sの表面上に所定のレーザ光を照射して、レーザ光が照射された部分を加熱するレーザ光発振器8が設けられている。なお、本実施の形態1では、レーザ光発振器8が発振するレーザ光により脆性材料基板Sの表面に加熱スポットを形成しているが、脆性材料基板Sをスポットとして加熱できるものであれば、レーザ光の他、赤外線、紫外線等を発生させる加熱源を用いてもよい。

上述のレーザ光発振器 8、ガラスカッター 5、冷却ノズル 7 は、ガイドレール 1 0 3 に沿った進行方向に沿って、この順に配置されており、レーザ発振器 8 から照射されるレーザ光の照射領域、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S上に接触する接触領域、冷却ノズル 7 から放出される冷却媒体によって冷却される冷却領域が、脆性材料基板 S上に互いに近接してこの順に形成さ

10

15

20

25



れるようになっている。

サーボモータ2の上部側には、駆動装置11、レーザ発振器8、冷却ノズル7等の上記各構成の駆動をそれぞれ制御する制御装置9が設けられている。この制御装置9には、駆動装置11によるガイドレール103方向に沿った、駆動装置11、レーザ発振器8および冷却ノズル7の移動の変位量(すなわち、本体フレーム4の移動の変位量)を検出すると共に、サーボモータ2の回転軸3の変位を検出することによって脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5のホイールチップ5aの上下動の変位量を検出するエンコーダが設けられている。

すなわち、スクライブの起点となる垂直クラックを形成するために設置されるガラスカッター5のホイールチップ5 a は、脆性材料基板S上の垂直クラックを形成しない部分においても、常時、脆性材料基板Sの表面に接触しており、脆性材料基板S上に存在する凹凸等によって、脆性材料基板Sの表面に接触するホイールチップ5 a に上下動が生じると、このホイールチップ5 a の上下動に伴って、ホルダ5 bを固定している支持フレーム4のフレーム本体部4 b にも上下動が生じ、この支持フレーム4のフレーム本体部4 b の上下動が、サーボモータ2の回転軸3の回転移動を発生させる。制御装置9に備えられたエンコーダにより、このサーボモータ2の回転軸3の回転を検出することによって、ホイールチップ5 a の上下動が検出される。

制御装置9は、エンコーダによって、ホイールチップ5aの変位量から脆性材料基板S表面の凹凸を検出することができ、この検出結果に基づいて、レーザ発振器8から照射されるレーザ光の焦点形成位置が調整されて、脆性材料基板Sの表面上の凹凸に追従してレーザ光は、そのピーム形状、波長やパルス幅に応じて照射対象物の表面、表面付近又は内部の所定一定深さ位置に焦点が合うように自動制御されて基板上を相対移動させられる。

なお、本実施の形態1では、冷却ノズル7が支持フレーム4のフレーム本体部 4 a の後端に一体的に取り付けられて、脆性材料基板Sの表面に接触するガラス

10

15

20

25



カッター5の上下動に追従して移動することにより、脆性材料基板Sの表面に対して常に同一の高さから冷却媒体が放出されるようになっているが、上記のレーザ光発振器8と同様に、冷却ノズル7の高さ位置を、エンコーダによる検出結果に基づいて調整するようにしてもよい。

次に、本実施の形態1のスクライブライン形成装置の動作について、図3 (a)~(e)を参照して説明する。

まず、図3(a)に示すように、ホィールチップ5aをテーブル後方側に位置する状態として、スクライブラインの形成対象となる脆性材料基板Sをテーブル101上の所定位置に固定する。

次に、駆動装置11および制御装置9を駆動させて、ホィールチップ5a、レーザ発振器8、冷却ノズル7を取り付けた支持フレーム4を、脆性材料基板Sの表面上を前方(図1の左方)に向けて移動させる。この状態では、ガラスカッター5のホィールチップ5aは、その高さ位置がテーブル101に載置された脆性材料基板Sに対して、若干下方位置になるように設置されている。また、制御装置9は、脆性材料基板Sの表面に過度の押圧力が下方に加わらないように、サーボモータ2によりガラスカッター5を取り付けた支持フレーム4にかかるトルクが制御されている。

駆動装置11の駆動により前進したガラスカッター5のホィールチップ5 aが 脆性材料基板Sの端部の位置に到達する。このとき、ガラスカッター5には、脆性材料基板Sの表面に垂直クラックを発生させる押圧力が加わらないように制御 されているため、脆性材料基板Sの表面より若干下方に設置されたホィールチップ5 a は、脆性材料基板Sの端部に接触した後、脆性材料基板Sの端部に欠け等を発生させることなく、そのまま脆性材料基板Sの表面上に乗り上がる。この脆性材料基板S表面上への乗り上げによって、ガラスカッター5に上下動が生じ、この上下動がサーボモータ2の回転軸3の回転に伝達され、ガラスカッター5の ホイールチップ5 a が脆性材料基板Sの表面に乗り上げられたことが、制御装置

10

15

20

25



9に備えられたエンコーダによって検出される。

エンコーダによってガラスカッター5のホィールチップ5 aが脆性材料基板Sの表面上に乗り上がったことが検出されると、制御装置9は、アマチュアー6のソレノイドコイル6 a に印加されている電圧をオフにする。これにより、アマチュアー6は、スプリングの付勢力によって下方に移動し、フレーム本体部4 aの上面に衝撃力を付与する。この衝撃力の付与によって、脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5のホィールチップ5 a は、脆性材料基板Sの表面上の端部に急俊な衝撃力を与え、脆性材料基板Sの表面上には、図3(b)に示すように、所定深さの垂直クラックTが形成される。次いで、再びソレノイドコイル6 a に電圧が印加され、アマチュアー6を上方に押し上げる電磁力が発生して、スプリングの下方への付勢力と上方に押し上げる電磁力とがつりあった状態となって、アマチュアー6は所定高さ位置において静止状態となる。

ガラスカッター5のホィールチップ5 a によって脆性材料基板Sの端部にスクライブの起点となる垂直クラックTが形成された後は、制御装置9は、脆性材料基板Sの表面にスクライブが形成されるほどの押圧力が加わらないように、脆性材料基板Sの表面への接触状態を維持する程度の微小な荷重が加えられるように、サーボモータ2を制御する。

脆性材料基板Sの表面に接触しながら転動するホイールチップ5 a を有するガラスカッター5は、脆性材料基板Sの表面上に凹凸、反り等があると、脆性材料基板Sに接触するホイールチップ5 a に上下動が生じ、このホイールチップ5 a の上下動に伴って、ホルダ5 b を固定している支持フレーム4にも上下動が生じ、この支持フレーム4の上下動によって、サーボモータ2の回転軸3に回転移動が生じる。制御装置9に備えられるエンコーダでは、このサーボモータ2の回転軸3の回転移動を検出することによって、脆性材料基板S上の凹凸、反り等を検出する。制御装置9は、このようにエンコーダによって検出された脆性材料基板S上の凹凸、反り等に基づいて、レーザ光発振器8の焦点位置の調整を行う。これ

10

15

20

25



により、脆性材料基板S上に凹凸等が生じていても、脆性材料基板Sの表面上又は内部の一定深さ位置に焦点が合った状態でレーザ光が照射される。また、冷却媒体を供給する冷却ノズル7は、支持フレーム4のフレーム本体部4bの後端部に一体的に取り付けられているので、脆性材料基板Sの表面の凹凸によって上下動するホイールチップ5aの動きに連動して、上下動するようになっており、冷却ノズル7は、脆性材料基板Sに対して、冷却ノズル7の先端と脆性材料基板Sとの間の距離が一定に保たれるようになっており、脆性材料基板Sに凹凸等があっても、常に適正に冷却媒体を供給できる位置とされる。

引き続いて、駆動装置11および制御装置9の駆動によって、図3(c)に示すように、レーザ光発振器8、ホィールチップ5a、冷却ノズル7のそれぞれが 脆性材料基板Sの表面上を一定方向に移動する。このとき、走査方向の前方側では、レーザ光発振器8によって照射されたレーザ光により、脆性材料基板Sの表面が溶融されない温度、すなわち、ガラス軟化点よりも低い温度に加熱される。これにより、レーザ光が照射される照射領域Lでは、脆性材料基板Sの表面が溶融されることなく加熱される。

また、脆性材料基板Sの表面におけるレーザ光の照射領域Lの近傍となる後方側には、冷却ノズル7から冷却媒体が放出されて、冷却領域Cが形成されている。レーザ光が照射されて加熱されるレーザ光照射領域Lの脆性材料基板Sの表面には、レーザ光による加熱によって圧縮応力が生じ、冷却媒体が放出される冷却領域Cには、冷却媒体によるガラス表面の冷却により引張り応力が生じる。このように、圧縮応力が生じたレーザ光照射領域Lに近接して引張り応力が生じるために、両領域間に、それぞれの応力に基づく応力勾配が発生し、脆性材料基板Sには、脆性材料基板Sの端部に形成された垂直クラックTを起点として、スクライブ予定ラインに沿って、ほぼ垂直クラックTの深さで、この垂直クラックが伸展していく。このように、順次、レーザ光発振器8、冷却ノズル7が一定方向に走査されることによって、走査方向に沿ったスクライブラインが形成される。

10

15

20

25

脆性材料基板Sの端部においてガラスカッター5のホイールチップ5aによっ て形成された垂直クラックTを起点として、レーザ光が照射されるレーザ光照射 領域Lと冷却媒体が放出される冷却領域Cとの応力勾配を利用したスクライブラ インの形成は、図3(d)に示すように、レーザ光照射領域Lと冷却領域Cとの 間に、走査方向に交差するスクライブラインSLCが既に形成されている場合に は、応力勾配が交差するスクライブラインSLCの部分で途切れた状態となって、 交差するスクライプラインSLCを超えて、スクライブラインを形成することが できない場合がある。そこで、本実施の形態1のスクライブライン形成装置では、 制御装置9に備えられたエンコーダによって、駆動装置11によるガイドレール 103に沿った本体フレーム4の移動距離が検出されており、制御装置9が、交 差するスクライブラインSLCが形成された位置を記憶することによって、ガラ スカッター5のホイールチップ5aが交差するスクライブラインSLCを超えた 位置に到達する直前に、アマチュアー6のソレノイドコイル6 a への電圧印加 (電流の供給) が停止される。この電圧のオフは、交差するスクライブライン S LCに到達するのと同時ではなく、ソレノイドコイル6aのインダクタンス成分 による電気的過渡遅れによる時間分とホイールチップ5 a が該交差位置 Z の真上 で所定の高さ位置迄上昇するだけの機械的慣性分の移動時間遅れ分を合計した時 間分だけ早めに電圧がオフにされる。その時間分は、コイルの電気的特性値と流 す電流値(必要なトルク値)とホイールチップ5 a の基板に対する相対移動速度 から求めることができる。そうして求めた時間遅れ分の値を予め制御装置9に記 **憶させておき、スクライブ条件が新たに設定されたり変更されたりする度に、対** 応する遅れ時間の値を記憶領域から読み出して使用する。そうした遅れ時間に相 当する時間分だけ早めにソレノイドコイル 6 a への通電を停止させることにより、 アマチュアー6は、スプリングの付勢力によって下方に移動し、支持フレーム4 の上面に衝撃力を付与する。この衝撃力の付与によって、脆性材料基板Sの表面 上の端部および図3 (e) に示した、該交差位置2の近傍には急俊な衝撃力が与

10

15

20



えられ、脆性材料基板Sの表面上の交差するスクライブラインSLCを超えた位置に、スクライブライン形成の起点となる所定深さの垂直クラックTが形成される。

これにより、スクライプラインSLを形成する途上に、走査方向に交差するスクライプラインSLCが形成されていても、垂直クラックTに連続したスクライプラインSLを確実に形成することができる。

以上説明したように、本実施の形態1のスクライブライン形成装置1は、ガラスカッター5の上方側に配置されたアマチュアー6からの衝撃力によって脆性材料基板Sの表面上に垂直クラックTを発生させるため、脆性材料基板Sの表面上の所望の位置にのみ急俊な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために充分な深さの垂直クラックTを発生させることができる。

アマチュアー6からの衝撃力は、前記従来の昇降装置による加圧力に比べると 極端に小さい力ですむので、装置の簡略化、小型化を図れる。

アマチュアー6から衝撃力が与えられない場合に、ガラスカッター5は、脆性 材料基板Sの表面に必要最小限のスクライブ圧で接触してスクライブ動作を実行 するので、ガラスカッター5のホィールチップ5aが脆性材料基板Sに乗り上が る際に脆性材料基板Sの端部に欠け等が発生することを防止することができる。

また、脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5のホィールチップ5aは脆性材料基板Sの表面上の凹凸等に対応して上下動を生じ、この上下動をサーボモータ2の回転軸3の回転からエンコーダが検出し、この検出結果に基づいて、レーザ発振器8の焦点位置を調整することができるので、脆性材料基板Sに凹凸等があっても、脆性材料基板Sの表面上又は所定深さの一定位置にレーザ光が適切に照射され、高精細なスクライブラインを表面又は内部に形成することができる。

25 さらに、ガラスカッター 5 のホィールチップ 5 a によりスクライプラインの起点となる垂直クラック T を形成し、この垂直クラック T をスクライプ予定ライン

10

15

20

25



に沿って伸展させる手段として、脆性材料基板Sにレーザ光による加熱と冷却媒体による冷却による温度勾配を形成し、形成された温度勾配に基づく脆性材料基板Sの熱歪みを利用しているため、カレットは起点付近にごくわずかに発生するのみとなり、従来の刃先を用いた方法と比較すると発生するカレットの量は激減する。

制御装置 9 は、ホィールチップ 5 a が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷 重で接触しながら移動されるよう駆動装置 1 1 の駆動を制御し、ホィールチップ 5 a が脆性基板 S の端部近傍および予め形成されたスクライブラインS L C の交 差位置 Z の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生 させるようアマチュアー 6 の駆動を制御するので、高精緻なスクライブライン S L を形成することができる。

(実施の形態2)

図4は、本実施の形態2のスクライブライン形成装置1'の概略を示す側面図であり、図5は、図4の \mathbb{N} — \mathbb{N} 線断面からのスクライブライン形成装置1'の正面図を示している。

本実施の形態2のスクライブライン形成装置1'は、図4に示すように、レーザ発振器8が、ガラスカッター5のホィールチップ5aが脆性材料基板Sの表面に接触する部分より後方側にレーザ光を照射するように、制御装置9から後方側(図中右方)に延びた位置に設けられている。

他の構成は、前述の実施の形態1のスクライブ形成装置1と同様となっている ので、詳しい説明は省略する。

このスクライブライン形成装置 1 では、ホィールチップ 5 a、レーザ発振器 8、冷却ノズル 7 が、ガイドレール 1 0 3 に沿った進行方向に沿って、この順に配置されており、ガラスカッター 5 のホイールチップ 5 a が脆性材料基板 S 上に接触する接触領域、レーザ発振器 8 から照射されるレーザ光の照射領域、冷却ノズル 7 から放出される冷却媒体によって冷却される冷却領域が、脆性材料基板 S

10

15

20

25



上に互いに近接して形成されるようになっている。

本実施の形態2のスクライブライン形成装置1'では、脆性材料基板Sの表面に接触した状態で移動するガラスカッター5のホィールチップ5aの上下動を、サーボモータ2の回転軸3の回転に基づいて、制御装置9に設けたエンコーダによって検出する。そして、この検出結果に基づいて、ガラスカッター5の後方側に配置されたレーザ発振器8のレーザ照射位置を調整する。

なお、本実施の形態2のスクライブライン形成装置1'の動作についても、前述の実施の形態1のスクライブライン形成装置1の動作と概略同一であり、この 実施の形態2のスクライブライン形成装置1'の動作について説明する図6

(a)~(e)を参照するとして、詳しい説明は省略する。

本実施の形態2のスクライブライン形成装置1、では、ガラスカッター5の上方側に配置されたアマチュアー6からの衝撃力によって脆性材料基板Sの表面上に垂直クラックTを発生させるため、脆性材料基板Sの表面上の所望の位置にのみ急俊な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために充分な深さの垂直クラックTを発生させることができ、アマチュアー6から衝撃力が与えられない場合には、ガラスカッター5のホィールチップ5 a は、脆性材料基板Sの表面に接触して所定のスクライブを発生させる軽度の荷重しか加えられていないので、ガラスカッター5のホィールチップ5 a が脆性材料基板Sに乗り上がる際に脆性材料基板Sの端部に欠け等が発生することを防止することができる。

また、脆性材料基板Sの表面上の凹凸等が、脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5のホィールチップ5aの上下動をサーボモータ2の回転軸3の回転からエンコーダが検出し、この検出結果に基づいて、レーザ発振器8の焦点位置を脆性材料基板Sに存在する凹凸に追従して調整することができるので、脆性材料基板Sの凹凸等があっても、脆性材料基板Sの表面上又は所定の深さの位置にレーザ光が適切に照射され、高精細なスクライブラインを形成することができる。

10

15

20

25



(実施の形態3)

図7は、本実施の形態3のスクライプライン形成装置1"の概略を示す側面図である。

本実施の形態3は、支持フレーム4の本体フレーム4aの下面において、ガラスカッター5の前方になる位置に、脆性材料基板Sの凹凸、反り等の変動をレーザ光の照射によって検出するレーザ変位計10が設けられている。他の構成は、前述の実施形態1のスクライブライン形成装置1と同様であり、詳しい説明は省略する。

また、本実施の形態3のスクライブライン形成装置1"の動作についても、脆性材料基板Sの表面の凹凸をレーザ変位計10を用いて検出する点以外は、前述の実施の形態1のスクライブライン形成装置の動作と概略同一であり、詳しい説明は省略する。

本実施の形態3のスクライブライン形成装置1"は、ガラスカッター5の上方側に配置されたアマチュアー6からの衝撃力によって脆性材料基板Sの表面上に垂直クラックを発生させるため、脆性材料基板Sの表面上の所望の位置にのみ急俊な衝撃力を発生させて、高精細に分断するために充分な深さの垂直クラックTを発生させることができ、アマチュアー6から衝撃力が与えられない場合には、ガラスカッター5のホィールチップ5aは、脆性材料基板Sの表面に接触して所定のスクライブを発生させる軽度の荷重しか加えられていないので、ガラスカッター5のホィールチップ5aが脆性材料基板Sに乗り上がる際に脆性材料基板Sの端部に欠け等が発生することを防止することができる。

また、脆性材料基板Sの表面上の凹凸等が、脆性材料基板Sの表面に接触しているガラスカッター5の前方側に設けられたレーザ変位計10によって検出され、この検出結果に基づいて、レーザ発振器8の焦点位置を脆性材料基板Sに存在する凹凸に追従して調整することができるので、脆性材料基板Sに凹凸等があっても、脆性材料基板Sの表面上又は内部の一定深さ位置に常に焦点が合った状態で

10

15

20



照射され、高精細なスクライブを形成することができる。

なお、脆性材料基板Sの表面上の凹凸等は、上記のレーザ変位計10のほかに、 接触式変位計を設けることによっても検出することができる。

上記の実施の形態1~3でそれぞれ説明したスクライブライン形成装置は、ガラスカッター5、冷却ノズル7およびレーザ光発振器8を固定して配置したが、スクライブライン形成条件に応じ、これらを互いの相対位置を変更できるように公知の技術を用いて支持フレーム4上に配置する構成としてもよい。これにより、スクライブライン形成条件に応じた適正なスクライブラインを形成することができる。なお、スクライブライン形成における諸条件とこれらの互いの相対位置との関係は日本国特許第3027768号の公報を参照されたい。

上記の実施の形態1~3でそれぞれ説明したスクライプライン形成装置は、脆性材料基板Sにスクライプラインの起点となる垂直クラックTを発生させるガラスカッター5のホィールチップ5aを、脆性材料基板Sの表面上の凹凸、反りを検出するようにしたので、装置構成を安価でコンパクトなものとすることができる。

本発明の特徴の一つとして、基板Sの端部または交差位置 Z を予めレーザ光によって加熱後、スクライブラインの起点となる垂直クラック T を形成させる事が可能なので、基板Sの端部または交差位置 Z における制御不能なクラックの発生を抑えることができる。

垂直クラックTの形成を進行方向において、端部をわずかに越えた基板内の位置で行い(内切りの開始)あるいはスクライブラインの形成を進行方向末端のわずか手前で終了する(内切りの終了)様に制御装置 9 を駆動することにより、上記の制御不能なクラックの発生を抑えることができる。

25 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明は、ガラスカッターのホィールチップを、脆性基

10

15



板の表面上に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら移動させ、この脆性基板上を移動するガラスカッターに対して所定深さの垂直クラックを発生させる急俊な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に垂直クラックを発生させる。そして、形成された垂直クラックに対して、スクライブ予定ラインに沿って、脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域が形成されるレーザ光を照射するレーザ光発振器と、脆性基板を冷却するための冷却媒体を放出する冷却ノズルとを配置し、脆性基板上におけるレーザ光発振器からレーザ光が照射される照射領域に生じる圧縮応力と該冷却ノズルから放出される冷却領域に生じる引張応力とにより発生する応力勾配によって、ガラスカッターによって形成された垂直クラックが、スクライブ予定ラインに沿って伸展させることによってスクライブラインを形成する。

したがって、本発明では、脆性基板の表面上に垂直クラックを発生させる所望の位置以外では、脆性基板に接触する程度の荷重がかかっており、過度の押圧力が脆性基板に付加することがないので、ガラスカッターのホィールチップが脆性基板上に乗り上がる場合等に脆性基板に欠け等の損傷を生じることを防止することができる。

また、脆性基板の表面に凹凸があったり、脆性基板に反りがある場合でも、脆性基板表面の高さに応じた適正なスクライブ条件を採り得るので、常に安定したスクライブラインを形成することができる。

20 さらに、スクライブラインの起点となる垂直クラックを刃先で形成する以外は、 その垂直クラックを脆性基板に生じる熱歪みを利用してスクライブ予定ラインに 沿って伸展させてスクライブラインを形成するため、カレットは起点付近にごく わずかに発生するのみとなり、従来の刃先を用いた方法と比較すると激減する。

15

25



請求の範囲

1. 先端に刃先を有し、押圧力を付与して刃先を脆性基板の表面に押圧し、スクライプラインの起点となる垂直クラックを形成するための垂直クラック形成部材と、

該脆性基板上の所望の位置で、所定の深さの垂直クラックを発生させるために、 該垂直クラック形成部材に対して急俊な衝撃力を付与する衝撃力付与手段と、

該脆性基板の軟化点よりも低い温度の領域を形成する加熱手段と、

該脆性基板を冷却する冷却手段と、

10 該加熱手段、該垂直クラック形成部材、衝撃力付与手段及び該冷却手段を、脆性基板の表面上に予め設定されたスクライプ予定ラインに沿って一定の間隔をあけた状態で、脆性基板に対して相対移動可能に配置された配置移動手段と、

衝撃力付与手段の駆動を制御する制御部とを備えたスクライブライン形成装置。

- 2. 制御部は、刃先が脆性基板表面に損傷を与えない程度の荷重で接触しながら 移動されるよう垂直クラック形成部材および配置移動手段の駆動を制御し、刃先 が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライブラインを通過する通過点 の近傍に位置するとき、脆性基板上に所定の深さの垂直クラックを発生させるよ う衝撃力付与手段の駆動を制御する請求の範囲第1項に記載のスクライブライン 形成装置。
- 20 3. 加熱手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動から 該脆性基板表面の高さ変化を検出し、この検出結果に基づいて前記レーザ光発振 器から照射されるレーザ光の焦点を調整するためのサーボ機構を具備してなる請 求の範囲第1項に記載のスクライブライン形成装置。
 - 4. 冷却手段は、脆性基板上を移動する前記垂直クラック形成部材の上下動に連動して上下動するよう配置移動手段に配置された請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。



- 5. 配置移動手段が、スクライプ予定ラインの前方側から、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段または、加熱手段、垂直クラック形成部材及び冷却手段のいずれかの順に前記3つの部材を配置してなる請求の範囲第1項に記載のスクライブライン形成装置。
- 5 6.配置移動手段が、垂直クラック形成部材、加熱手段及び冷却手段を、互いの相対位置を変更できるように配置してなる請求の範囲第1項に記載のスクライブライン形成装置。
 - 7. 冷却手段は、冷却手段の高さ位置を調整するサーボ機構を有する請求の範囲第1項に記載のスクライプライン形成装置。
- 10 8. 垂直クラック形成部材は、ホイールチップを刃先としてこれを転動可能に支持したガラスカッターである請求の範囲第1項に記載のスクライブライン形成装置。
 - 9. 加熱手段が、所定のレーザ光を照射するレーザ光発振器である、請求の範囲 第1項に記載のスクライプライン形成装置。
- 10. 冷却手段が、冷却媒体を放出する冷却ノズルである、請求の範囲第1項に 記載のスクライブライン形成装置。
 - 11. 衝撃力付与手段は、ソレノイドコイルへの通電をオンまたはオフすることによって、刃先を脆性基板表面上に押圧する移動慣性を発生させるアマチュアーである、請求の範囲第1項に記載のスクライブライン形成装置。
- 20 1 2. 脆性基板の表面の高さ変化を検出するためのレーザ変位計および接触式変位計のいずれか1つをさらに具備してなる請求の範囲第1項~第11項のいずれか1つに記載のスクライブライン形成装置。
 - 13. 脆性基板が、液晶表示装置用ガラス基板、プラズマディスプレイパネル用ガラス基板および有機ELディスプレイパネル用ガラス基板の中から選択された
- 25 1 つである請求の範囲第 1 項~第 1 2 項のいずれか 1 つに記載のスクライブライン形成装置。

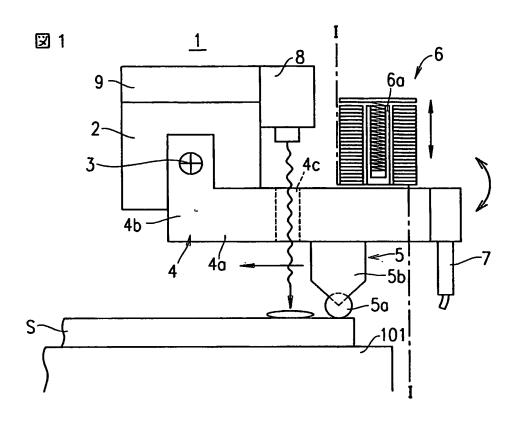


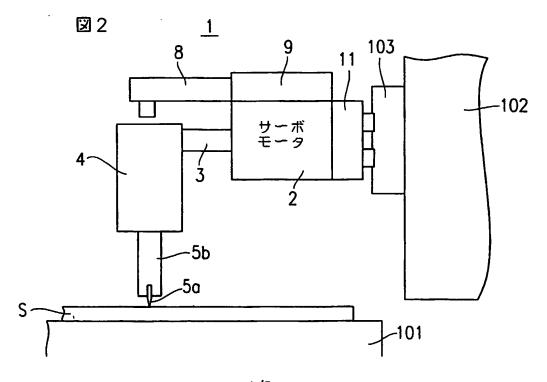
14. 先端に刃先を有する垂直クラック形成部材を脆性基板上を移動させながら 刃先に急俊な衝撃力を与える衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置 に所定深さの垂直クラックを発生させる工程と、

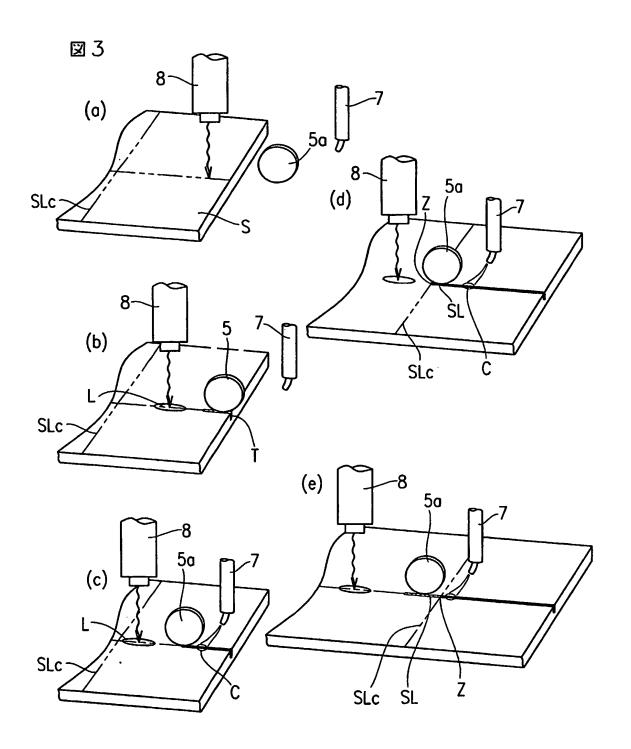
該垂直クラックに対して、基板上に設定されたスクライブ予定ラインに沿って、 該脆性基板の軟化点よりも低い温度の照射領域を形成すると共に、該照射領域の 後方に冷却領域を形成してスクライブラインを形成する工程と、

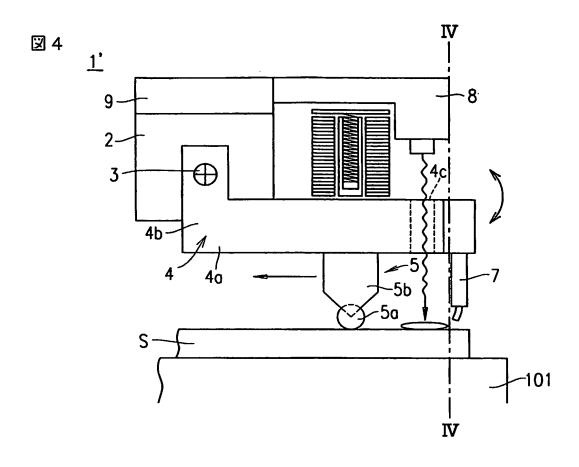
を包含することを特徴とするスクライブ形成方法。

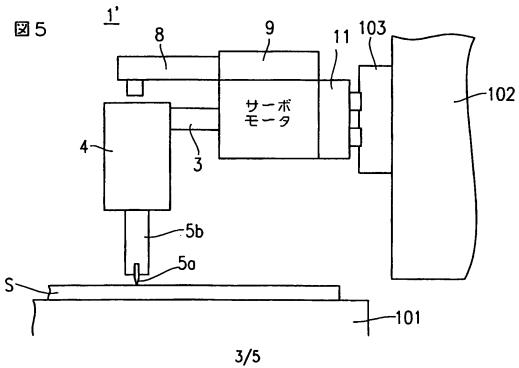
15. 刃先が脆性基板の端部近傍および予め形成されたスクライブラインと交差する交差位置の近傍に位置するとき、衝撃力付与手段によって、脆性基板上の所望の位置に所定深さの垂直クラックを発生させる請求の範囲第14項に記載のスクライブライン形成方法。

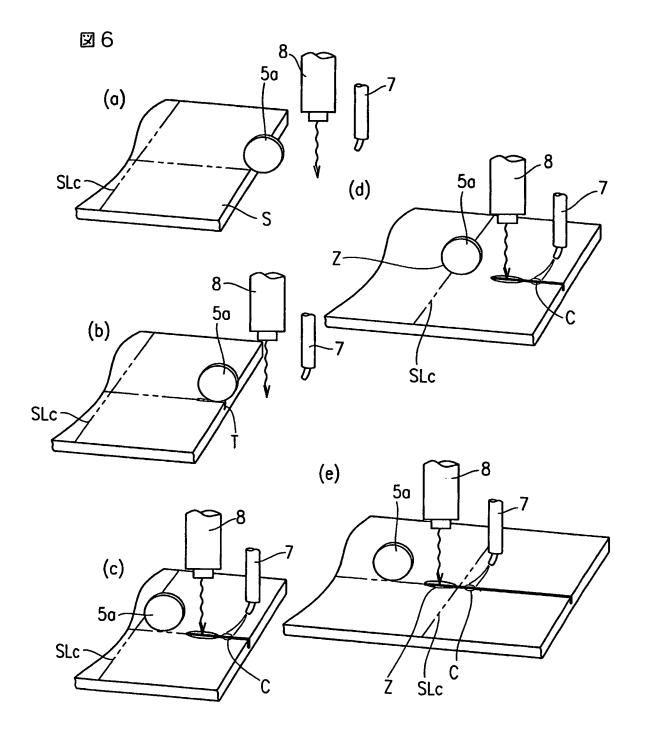


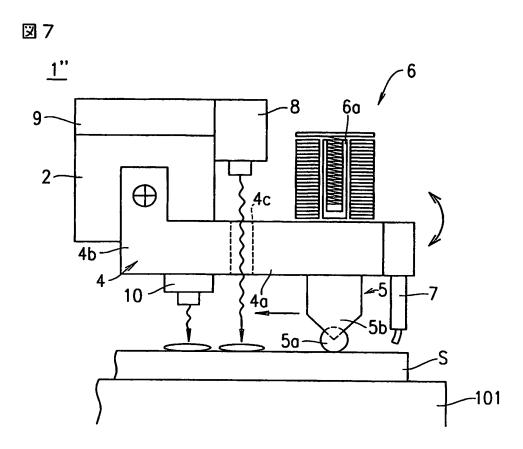














International application No.
PCT/JP03/14080

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B28D5/00, C03B33/03, C03B33/023				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
	S SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B28D5/00-5/04, C03B33/00-33/14				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
А	JP 2000-63137 A (Toyota Moto 29 February, 2000 (29.02.00), Claims 1, 2; Fig. 1 (Family: none)		. 1–15	
· A	JP 2002-308637 A (Sony Corp. 23 October, 2002 (23.10.02), Par. Nos. [0051] to [0054]; F (Family: none)		1-15	
A .	JP 2001-151525 A (Mitsuboshi Kabushiki Kaisha), 05 June, 2001 (05.06.01), Claim 2; Figs. 12, 13 (Family: none)	Diamond Kogyo	1-15	
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" carlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report		
03 F	Tebruary, 2004 (03.02.04)	17 February, 2004	(17.02.04)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		



International application No.
PCT/JP03/14080

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-61676 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 29 February, 2000 (29.02.00), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	1-15
A	JP 2001-58317 A (Kabushiki Kaisha Berudekkusu), 06 March, 2001 (06.03.01), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	1-15

国際出願番号 PCT/JP03/14080 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' B28D5/00, C03B33/03, C03B33/023 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' B28D5/00-5/04, C03B33/00-33/14最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー* 1 - 15JP 2000-63137 A (トヨタ自動車株式会社) 200 Α 0.02.29,請求項1,請求項2,図1 (ファミリーなし) JP 2002-308637 A (ソニー株式会社) 2002. 1 - 15Α 10.23, 【0051】-【0054】, 図10-15 (ファミ リーなし) JP 2001-151525 A (三星ダイヤモンド工業株式会 1 - 15Α 社) 2001.06.05,請求項2,図12,図13(ファミ リーなし) |X| C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 17. 2. 2004 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 03.02.2004 特許庁審査官(権限のある職員) 3 P 8815 国際調査機関の名称及びあて先

紀本 孝

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



国際出願番号 РС1/ЈР03/14080

	C (続き). 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する				
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	開求の範囲の番号			
A	JP 2000-61676 A (旭硝子株式会社) 2000.0 2.29,請求項1,図1 (ファミリーなし)	1-15			
A	JP 2001-58317 A (株式会社ベルデックス) 200 1.03.06,請求項1,図1 (ファミリーなし)	1-15			
	·				